PAT-NO: JP362054637A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62054637 A

TITLE: ELECTROSTATIC CHUCK

PUBN-DATE: March 10, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SOTOZONO, MAKOTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOKUDA SEISAKUSHO LTD N/A

APPL-NO: JP60191586

APPL-DATE: August 30, 1985

INT-CL (IPC): B23Q003/15, H01L021/68

US-CL-CURRENT: 269/8

### ABSTRACT:

PURPOSE: To detect an abnormal state such as dropping or unclamping, etc.,

of a chucked work as well as to make reliability in a chuck improvable, by

installing a device detecting such voltage to be impressed on an electrode, and

also detecting a setting state of the chucked work from the voltage value.

CONSTITUTION: In the state that a power circuit 8 is connected to an

electrode 3, voltage comes low when a chucked work 5 is not yet attracted as

compared with a time when this chucked work is attracted to the electrode 3.

It means that when the chucked work 5 comes off the electrode 3, a current

flows between the electrode 3 and a vessel 1. Especially, when such one being

once attracted drops down as a hole is opened in a dielectric thin film 2, a

sudden variation in voltage occurs. This phenomenon is outputted as an

abnormal signal by a comparator circuit comparing a detection voltage of a

voltmeter with a reference voltage. When a switch 9 is turned on and the DC

high tension power circuit 8 is connected to the electrode 3, owing to the

static electricity generated by this connection, the chucked work 5 is

attracted to a lower surface of the electrode 3.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-54637

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)3月10日

B 23 Q 3/15

Z-7041-3C 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

静電チャツク装置

罛

②特 願 昭60-191586

**20出 願 昭60(1985)8月30日** 

**7**9発 明 者 外

詖

座間市相模が丘6の25の22 株式会社徳田製作所内

⑪出 顋 人 株式会社 徳田製作所

座間市相模が丘6の25の22

邳代 理 人 弁理士 鈴江 武彦

外2名

明 細 著

1. 発明の名称

静電チャック装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 下面に絶縁層を形成した選極と、この電極に直流高電圧を印加する電源回路とを備え、上記絶縁層の下面に被処理物を静電的に吸着する静電チャック装置において、前記電極に印加される電圧或いは前記電極に流れる電流を検出する手段を設け、該電圧或いは電流の値から前記被処理物の箝脱状態を検出することを特徴とする静電チャック数置。
- (2) 前記電極は、真空容器の上壁からなるものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の静電チャック装置。
- (3) 前記超極及び絶録層の一部に貫通孔が形成され、前記超極から前記超源回路を切り離した状態で上記貫通孔からガスを導入することにより前記被処理物を落下させることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の静磁チャック装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、静電チャック装置に係わり、特に被処理物の普脱状態検出機能を備えた静電チャック装置に関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

近年、半導体装置は微細化及び高集積化が進み、その結果として回路索子の最小寸法が1 [μm] 近くまで達している。このような超しSIを製造する過程においては、微細なゴミも重大な問題となる。そこで、半導体ウェハ等の被処理物の表面に対るのを防止する手法と処理物の表面(被処理面)を下にした処理物を静電的に保持する静電チャック装置が提案されている。

第1図はこの種の静電チャック装置を用いたプラズマ処理装置を示す概略構成図である。 奥空容器 1 の上部にポリイミド等の誘性体徴膜 (絶縁層) 2 を被着した電極 3 が配置され、この電極 3 は非素樹脂等の絶縁環 4 を介して容器 1 に固定されて

# 特開昭62-54637(2)

そこで、予め排気口13から真空ポンプ(図示せず)等により排気されている真空容器1にガス 導入管14より所定のガスを入れ、高周波電源 10等を用い容器1と電極3との間に放電プラズ マを生成して被処理物5を処理する。

被処理物 5 の脱離は、保持台 7 を上下駆動器 6 でに好させ、保持台 7 で電極下面の被処理物 5 を 支持する。高圧直流電源回路 8 を開閉器 9 により 切断し、静電気の保持を中断する。静電気が放電 したら、通常接着時には真空になっている孔部

契常が起こると複数個の被処理物を破損すると云うこともあった。

# (発明の目的)

#### 〔発明の概要〕

本発明の骨子は、被処理物が吸着状態にあるか 否かにより変化する電極の選圧或いは選極に流れ る電流を検出することにある。

即ち本発明は、下面に絶縁層を形成した電極と、この電極に直流高電圧を印加する電源回路とを備え、上記絶縁層の下面に被処理物を静穏的に吸着する部電チャック装置において、前記電極に印加される電圧或いは前記電極に流れる電流を検出する手段を設け、該電圧或いは電流の値から前記を検出するようにしたものである。

1 1 に被処理物 5 が破損しない程度の圧力で窒素等のガス 1 2 を流す。その状態で上下駆動器 6 により保持台 7 を下げると、被処理物 5 は保持台 7 と共に下がり、搬送可能な状態となる。

このような静電チャック装置は、徐々に改良が加えられ、現在ではかなりの信頼度があり、いろいろな用途に使用されている。

従って、未接着若しくは落下した被処理物は、 内眼等によって初めて確認できた。通常、被処理 物は高価なものであり、しかもこの稲の応用装置 は自動で働くものが主流となっているので、一旦

#### (発明の効果)

本発明によれば、電極に印加される電圧或いは電極に流れる電流を検出することによって、被処理物が電極に吸着されているか否かを容易に検知することができる。このため、被処理物の落下或いは未接着等の異常状態を検知することができ、信頼性の向上をはかり得る。

#### (発明の実施例)

以下、本発明の詳細を図示の実施例によって説明する。

での実施例は静電チャック装置をブラズマ処理 装置に適用した例である。ブラズマ処理袋と同様 であり、変置の基本構成は類にあるはは、静また であり、変置の電極3に直流にかけれるの路ののであり、でで変してある。即ち、電源とりがある。のはのではないである。の路とはないである。はないでである。はないではないでは、ではないでででである。この整流出から、はいる。このとの路との出りにででである。また、電源回路8の出りにはないでは、では、電源回路8の出りにはないでは、では、電源回路8の出りには、では、電源回路8の出りには、できる。このをは、電源回路8の出りに

# 特開昭62-54637(3)

は電圧計18で検出され、出力電流は電流計19で検出されるものとなっている。

上記災常信号は、リレー接点 2 3 の O N - O F F 或いはアナログ信号 2 4 として取出され、リレー制御回路 2 5 或いはマイコン等を使った自動制御回路 2 6 で検知される。そして、異常時はランブ、C R T 等 2 7 により表示し、またブザー

らに、電極の印加電圧或いは電極に流れる電流なく、 他出する手段は、必ずしも両方設ける必要はなり、 その少なくとも一方を設ければよい。また、実施 例ではエッチング・スパッタリング等のプラズマ 処理などに適用した例を説明したが、被処理などの 処理面を下にして使用する各種の半導体処理装置 に適用することが可能である。その他、本発明の ど音を逸脱しない範囲で、種々変形して実施する ことができる。

## 4. 図面の簡単な説明

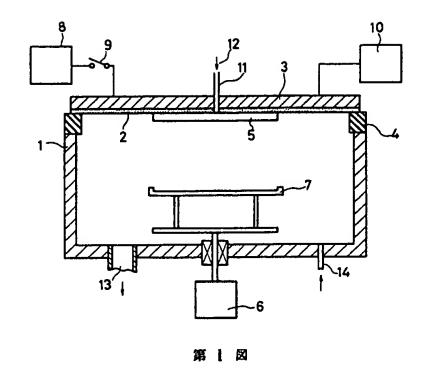
第1図は本発明の一実施例に係わる静電チャック装置を用いたプラズマ処理装置を示す概略構成図、第2図は上記静電チャックの電源回路を示す回路構成図、第3図は上記実施例における検出及び処理に関するシーケンスを示す模式図である。

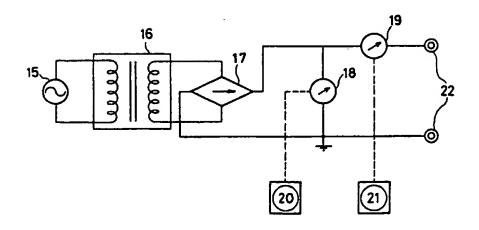
1 ··· 與空容器、 2 ··· 誘電体薄膜(艳绿冠)、 3 ··· 電極、 4 ··· 艳绿琛、 5 ··· 被処理物、 6 ··· 上下驱動器、 7 ··· 保持台、 8 ··· 直流高压電源回路、 9 ··· 開閉器、 1 0 ··· 高周波電源、 1 1 ··· 孔部( ガス導入管)、 1 3 ··· 排纸口、 1 4 ··· ガス導入管、

好28により警報を出すものとなっている。

なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。例えば、前記電極の材料は導電体であればよく、さらに電極の下面に形成した絶縁層はポリイミドに限らず適宜変更可能である。また、 典空容器の上壁を電極として兼用する代りに、容 器内に新たな電極を設けるようにしてもよい。さ

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦





第 2 図

23 20 21 21 24 第 3 图

--244--